

# 2024-2030年中国光刻机市场 前景研究与投资前景报告

## 报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

[www.chinairr.org](http://www.chinairr.org)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国光刻机市场前景研究与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R05/R0502/202311/09-578279.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

光刻机 (Mask Aligner) 又名：掩模对准曝光机，曝光系统，光刻系统等。常用的光刻机是掩膜对准光刻，所以叫 Mask Alignment System.

光刻机分为无掩模光刻机和有掩模光刻机。无掩模光刻机可分为电子束直写光刻机、离子束直写光刻机、激光直写光刻机。电子束直写光刻机可以用于高分辨率掩模版以及集成电路原型验证芯片等的制造，激光直写光刻机一般是用于小批量特定芯片的制造。有掩模光刻机分为接触/接近式光刻机和投影式光刻机。接触式光刻和接近式光刻机出现的时期较早，投影光刻机技术更加先进，图形比例不需要为1:1，减低了掩模板制作成本，目前在先进制程中广泛使用。随着曝光光源的改进，光刻机工艺技术节点不断缩小。

目前最先进的光刻机来自ASML的EUV光刻机，采用13.5nm光源，最小可以实现7nm的制程。此设备的开发难度更高，使用条件更复杂目前只有ASML攻破此项技术。因为所有物质吸收EUV辐射，用于收集光（收集器），调节光束（照明器）和图案转移（投影光学器件）的光学器件必须使用高性能钼硅多层反射镜，并且必须容纳整个光学路径在近真空环境中，整个设备十分复杂。

光刻机经历了五代发展

光刻机经历了五代发展

-

光源

波长 (nm)

类型

制程 (nm)

第一代

g-line

436

接触接近式

800-250

第二代

i-line

365

接触接近式

800-250

第三代

KrF

248

扫描投影式

180-130

第四代

ArF

193

浸没步进式

45-22

步进投影式

130-65

第五代

EUV

13.5

极紫外式

7月22日

数据来源：公开资料整理

产业研究报告网发布的《2024-2030年中国光刻机市场前景研究与投资前景报告》共十四章。

首先介绍了光刻机行业市场发展环境、光刻机整体运行态势等，接着分析了光刻机行业市场运行的现状，然后介绍了光刻机市场竞争格局。随后，报告对光刻机做了重点企业经营状况分析，最后分析了光刻机行业发展趋势与投资预测。您若想对光刻机产业有个系统的了解或者想投资光刻机行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 光刻机行业发展综述

1.1 光刻机行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业主要产品分类

- 1.1.3 行业主要商业模式
- 1.2 光刻机行业特征分析
  - 1.2.1 产业链分析
  - 1.2.2 光刻机行业在国民经济中的地位
  - 1.2.3 光刻机行业生命周期分析
    - (1) 行业生命周期理论基础
    - (2) 光刻机行业生命周期
- 1.3 最近3-5年中国光刻机行业经济指标分析

## 第二章 光刻机行业运行环境分析

- 2.1 光刻机行业政治法律环境分析
  - 2.1.1 行业管理体制分析
  - 2.1.2 行业主要法律法规
  - 2.1.3 行业相关发展规划
- 2.2 光刻机行业经济环境分析
  - 2.2.1 宏观经济形势分析
  - 2.2.2 国内宏观经济形势分析
  - 2.2.3 产业宏观经济环境分析
- 2.3 光刻机行业社会环境分析
  - 2.3.1 光刻机产业社会环境
  - 2.3.2 社会环境对行业的影响
  - 2.3.3 光刻机产业发展对社会发展的影响
- 2.4 光刻机行业技术环境分析
  - 2.4.1 光刻机技术分析
  - 2.4.2 光刻机技术发展水平
  - 2.4.3 行业主要技术发展趋势

## 第三章 我国光刻机所属行业运行分析

- 3.1 我国光刻机行业发展状况分析
  - 3.1.1 我国光刻机行业发展阶段
  - 3.1.2 我国光刻机行业发展总体概况
  - 3.1.3 我国光刻机行业发展特点分析

### 3.2 2024-2030年光刻机行业发展现状

ASML在高端EUV、ArFi、ArF机型市场占有率不断提升。2017年ASML上述三种机型出货量总计为101台，市场份额占比为78.29%，到2018年ASML出货量增长到120台，市场份额约90%。2018年ASML共出货224台光刻机，较2017年198年增加26台，增长13.13%。Nikon2018年度（非财年）光刻机共出货106台，半导体用光刻机出货36台，同比增长33.33%，面板（FPD）用光刻机出货70台。2018年Canon光刻机出货183台，同比增1.6%。半导体用光刻机出货达114台，增长62.85%。但是主要是i-line、KrF两个低端机台出货，其面板（FPD）用光刻机出货69台。

IC前道光刻机国产化严重不足。目前国内光刻机处于技术领先的是上海微电子，其最先进的ArF光源光刻机节点为90nm，中国企业技术整体较为落后，在先进制程方面与国外厂商仍有较大差距。

2018年三大光刻机巨头各类光刻机出货量情况（单位：台）

2018年三大光刻机巨头各类光刻机出货量情况（单位：台）

-  
ASML  
NIKON  
CANON  
半导体用光刻机  
EUV  
18  
0  
114  
ArFi  
86  
5  
ArF  
16  
9  
KrF  
78  
5  
i-line

26

17

面板用光刻机

-

0

70

69

总计

-

224

106

183

数据来源：公开资料整理

3.2.1 2024-2030年我国光刻机行业市场规模

3.2.2 2024-2030年我国光刻机行业发展分析

3.2.3 2024-2030年中国光刻机企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2024-2030年重点省市市场分析

3.4 光刻机细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2024-2030年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 光刻机产品/服务价格分析

3.5.1 2024-2030年光刻机价格走势

3.5.2 影响光刻机价格的关键因素分析

3.5.3 2024-2030年光刻机产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要光刻机企业价位及价格策略

第四章 我国光刻机所属行业整体运行指标分析

4.1 2024-2030年中国光刻机所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

- 4.1.2 人员规模状况分析
- 4.1.3 所属行业资产规模分析
- 4.1.4 行业市场规模分析
- 4.2 2024-2030年中国光刻机所属行业产销情况分析
  - 4.2.1 我国光刻机所属行业工业总产值
  - 4.2.2 我国光刻机所属行业工业销售产值
  - 4.2.3 我国光刻机所属行业产销率
- 4.3 2024-2030年中国光刻机所属行业财务指标总体分析
  - 4.3.1 所属行业盈利能力分析
  - 4.3.2 所属行业偿债能力分析
  - 4.3.3 行业营运能力分析
  - 4.3.4 行业发展能力分析

## 第五章 我国光刻机行业供需形势分析

- 5.1 光刻机行业供给分析
  - 5.1.1 2024-2030年光刻机行业供给分析
  - 5.1.2 2024-2030年光刻机行业供给变化趋势
  - 5.1.3 光刻机行业区域供给分析
- 5.2 2024-2030年我国光刻机行业需求情况
  - 5.2.1 光刻机行业需求市场
  - 5.2.2 光刻机行业客户结构
  - 5.2.3 光刻机行业需求的地区差异
- 5.3 光刻机市场应用及需求预测
  - 5.3.1 光刻机应用市场总体需求分析
    - (1) 光刻机应用市场需求特征
    - (2) 光刻机应用市场需求总规模
  - 5.3.2 2024-2030年光刻机行业领域需求量预测
    - (1) 2024-2030年光刻机行业领域需求产品/服务功能预测
    - (2) 2024-2030年光刻机行业领域需求产品/服务市场格局预测
  - 5.3.3 重点行业光刻机产品/服务需求分析预测

## 第六章 光刻机行业产业结构分析



- 6.1 光刻机产业结构分析
  - 6.1.1 市场细分充分程度分析
  - 6.1.2 各细分市场领先企业排名
  - 6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例
  - 6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）
- 6.2 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
  - 6.2.1 产业价值链的构成
  - 6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析
- 6.3 产业结构发展预测
  - 6.3.1 产业结构调整指导政策分析
  - 6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素
  - 6.3.3 中国光刻机行业参与竞争的战略市场定位
  - 6.3.4 产业结构调整方向分析

## 第七章 我国光刻机行业产业链分析

- 7.1 光刻机行业产业链分析
  - 7.1.1 产业链结构分析
  - 7.1.2 主要环节的增值空间
  - 7.1.3 与上下游行业之间的关联性
- 7.2 光刻机上游行业分析
  - 7.2.1 光刻机产品成本构成
  - 7.2.2 2024-2030年上游行业发展现状
  - 7.2.3 2024-2030年上游行业发展趋势
  - 7.2.4 上游供给对光刻机行业的影响
- 7.3 光刻机下游行业分析
  - 7.3.1 光刻机下游行业分布
  - 7.3.2 2024-2030年下游行业发展现状
  - 7.3.3 2024-2030年下游行业发展趋势
  - 7.3.4 下游需求对光刻机行业的影响

## 第八章 我国光刻机行业渠道分析及策略

- 8.1 光刻机行业渠道分析

- 8.1.1 渠道形式及对比
- 8.1.2 各类渠道对光刻机行业的影响
- 8.1.3 主要光刻机企业渠道策略研究
- 8.1.4 各区域主要代理商情况
- 8.2 光刻机行业用户分析
  - 8.2.1 用户认知程度分析
  - 8.2.2 用户需求特点分析
  - 8.2.3 用户购买途径分析
- 8.3 光刻机行业营销策略分析
  - 8.3.1 中国光刻机营销概况
  - 8.3.2 光刻机营销策略探讨
  - 8.3.3 光刻机营销发展趋势

## 第九章 我国光刻机行业竞争形势及策略

- 9.1 行业总体市场竞争状况分析
  - 9.1.1 光刻机行业竞争结构分析
  - 9.1.2 光刻机行业企业间竞争格局分析
  - 9.1.3 光刻机行业集中度分析
  - 9.1.4 光刻机行业SWOT分析
- 9.2 中国光刻机行业竞争格局综述
  - 9.2.1 光刻机行业竞争概况
    - (1) 中国光刻机行业竞争格局
    - (2) 光刻机行业未来竞争格局和特点
    - (3) 光刻机市场进入及竞争对手分析
  - 9.2.2 中国光刻机行业竞争力分析
    - (1) 我国光刻机行业竞争力剖析
    - (2) 我国光刻机企业市场竞争的优势
    - (3) 国内光刻机企业竞争能力提升途径
  - 9.2.3 光刻机市场竞争策略分析

## 第十章 光刻机行业领先企业经营形势分析

### 10.1 ASML

- 10.1.1 企业概况
- 10.1.2 企业优势分析
- 10.1.3 产品/服务特色
- 10.1.4 公司经营状况
- 10.1.5 公司发展规划
- 10.2 尼康 ( Nikon )
- 10.2.1 企业概况
- 10.2.2 企业优势分析
- 10.2.3 产品/服务特色
- 10.2.4 公司经营状况
- 10.2.5 公司发展规划
- 10.3 佳能 ( Canon )
- 10.3.1 企业概况
- 10.3.2 企业优势分析
- 10.3.3 产品/服务特色
- 10.3.4 公司经营状况
- 10.3.5 公司发展规划
- 10.4 上海微电子
- 10.4.1 企业概况
- 10.4.2 企业优势分析
- 10.4.3 产品/服务特色
- 10.4.4 公司经营状况
- 10.4.5 公司发展规划

## 第十一章 2024-2030年光刻机行业投资前景

- 11.1 2024-2030年光刻机市场发展前景
  - 11.1.1 2024-2030年光刻机市场发展潜力
  - 11.1.2 2024-2030年光刻机市场前景展望
  - 11.1.3 2024-2030年光刻机细分行业发展前景分析
- 11.2 2024-2030年光刻机市场发展趋势预测
  - 11.2.1 2024-2030年光刻机行业发展趋势
  - 11.2.2 2024-2030年光刻机市场规模预测

- 11.2.3 2024-2030年光刻机行业应用趋势预测
- 11.2.4 2024-2030年细分市场发展趋势预测
- 11.3 2024-2030年中国光刻机行业供需预测
  - 11.3.1 2024-2030年中国光刻机行业供给预测
  - 11.3.2 2024-2030年中国光刻机行业需求预测
  - 11.3.3 2024-2030年中国光刻机供需平衡预测
- 11.4 影响企业生产与经营的关键趋势
  - 11.4.1 市场整合成长趋势
  - 11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测
  - 11.4.3 企业区域市场拓展的趋势
  - 11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展
  - 11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

## 第十二章 2024-2030年光刻机行业投资机会与风险

- 12.1 光刻机行业投融资情况
  - 12.1.1 行业资金渠道分析
  - 12.1.2 固定资产投资分析
  - 12.1.3 兼并重组情况分析
- 12.2 2024-2030年光刻机行业投资机会
  - 12.2.1 产业链投资机会
  - 12.2.2 细分市场投资机会
  - 12.2.3 重点区域投资机会
- 12.3 2024-2030年光刻机行业投资风险及防范
  - 12.3.1 政策风险及防范
  - 12.3.2 技术风险及防范
  - 12.3.3 供求风险及防范
  - 12.3.4 宏观经济波动风险及防范
  - 12.3.5 关联产业风险及防范
  - 12.3.6 产品结构风险及防范
  - 12.3.7 其他风险及防范

## 第十三章 光刻机行业投资战略研究

## 13.1 光刻机行业发展战略研究

### 13.1.1 战略综合规划

### 13.1.2 技术开发战略

### 13.1.3 业务组合战略

### 13.1.4 区域战略规划

### 13.1.5 产业战略规划

### 13.1.6 营销品牌战略

### 13.1.7 竞争战略规划

## 13.2 对我国光刻机品牌的战略思考

### 13.2.1 光刻机品牌的重要性

### 13.2.2 光刻机实施品牌战略的意义

### 13.2.3 光刻机企业品牌的现状分析

### 13.2.4 我国光刻机企业的品牌战略

### 13.2.5 光刻机品牌战略管理的策略

## 13.3 光刻机经营策略分析

### 13.3.1 光刻机市场细分策略

### 13.3.2 光刻机市场创新策略

### 13.3.3 品牌定位与品类规划

### 13.3.4 光刻机新产品差异化战略

## 13.4 光刻机行业投资战略研究

### 13.4.1 2022年光刻机行业投资战略

### 13.4.2 2024-2030年光刻机行业投资战略

### 13.4.3 2024-2030年细分行业投资战略

## 第十四章 研究结论及投资建议

### 14.1 光刻机行业研究结论

### 14.2 光刻机行业投资价值评估

### 14.3 光刻机行业投资建议

#### 14.3.1 行业发展策略建议

#### 14.3.2 行业投资方向建议

#### 14.3.3 行业投资方式建议

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R05/R0502/202311/09-578279.html>